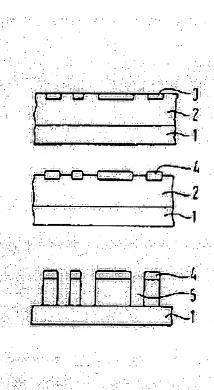
Abstract of JP1245215

PURPOSE: To substantially shorten the acquisition time of complete images by using a primary light beam composed of plural secondary light beams (element light beams). CONSTITUTION: The primary light beam composed of the plural secondary beams is converged and spatially filtered by a converging and filtering device 12 so as to obtain beams for which the illuminance of a cross-section is uniformly distributed. Then, the primary beam is re-converged on a test object by a converging device 30. The foci of the respective secondary beams are distributed over heights z1, z2 ... zn. The secondary beams are reflected from the test object and returned to a detector 20 by a separation plate 18 and only the secondary beam correctly converged on the surface of the test object is re-converged at the conjugate point P of the focus. Thus, the scanning optical microscope for each depth of an extension visual field is executed by single scanning by the beam of the test object. Also, the need of continuous image acquisition is eliminated, and thus, the acquisition time of the complete images is substantially shortened.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-245215

filnt, Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成1年(1989)9月29日

G 02 B 26/10 G 01 N 21/17 B-7348-2H A-7458-2G

審査請求 未請求 請求項の数 16 (全10 頁)

❷発明の名称

拡張視野の走査共焦光学検鏡的及び深度別的試験の方法とそのため の装置

②特 願 平1-16073

20出 願 平1(1989)1月25日

優先権主張

- 1988年1月27日匈フランス(FR) - 1988800934

@発明者

ベルナール ピカール

フランス国、サン マルタン デール 38400 リユ ジ

ヨルジュ ビゼー 8

勿出 願 人 コミサリヤ タア レ

.

フランス国、パリ 75015 リユ ド ラ フェデラシオ

ネジ アトミク

ン 31/33

何代 理 人 弁理士 重 野 剛

明 和 會

1. 発明の名称

拡張視野の走査共焦光学検鎖的及び深度別的試験の方法とそのための装置

2. 特許請求の範囲

(1) 拡張視野の走査共焦光学検鏡的及び深度 別的試験の方法に於て、

少なくとも1つの特性に於て相互に区別される 複数の二次光ピームにより構成された一次光ピー ムが形成され、

集光装置によって各二次光ビームが高さの異なるポイントで試験対象上に集光され、

試験対象から反射した二次光ビームが検出システムに送られ、

二次光ピームの照度の検出がなされ、

検出された信号のデジタル分析と処理がなさ n

試験される全ての対象に関して一次光ビームの 走査が行なわれる各段階から成ることを特徴とす る拡張視野の走査共焦光学検続的及び深度別的試

験の方法。

- (2) 二次光ビームはそれぞれの二次光ビーム ごとに異なる波長に於て相互に区別されることを 特徴とする請求項1記載の方法。
- (3) それぞれの二次光ビームごとに固有に一時的に変調される振幅に於て二次光ビームは相互に区別されることを特徴とする請求項1記載の方法。
- (4) 試験対象の方向に延びる一次光ピームを 供給する光源と、

空間的進光及び集光装置と、

前記ピームを研究対象上に集光する集光装置と、

`試験対象から反射した光ビームを戻す分離板 ▶

集光装置の焦点の共役点におかれたダイアフラムを含んで成り、出力に信号を供給する検出システムと、

検出システムの出力に接続された入力を有する デジタル処理及び分析システムと、 を含んで構成されており、

前記光源は多色であり、一次光ビームは波長が異なる複数の二次光ビームから成り、且つ集光装置は色収差を生じることを特徴とする請求項1記載の方法を実行するための装置。

(5) 分離板により戻された試験対象からの反射ビームの光路上に配置され、前記反射ビームを 構成する波長の異なる二次光ビームを空間的に分 離する側方分散光学システムと、

側方分散光学システムにより分離された二次光 ビームを受ける各システムに適した検出システムは集光装置の焦 を更に含み、各検出システムは集光装置の焦 の共役点に配置されたダイアフラムを含んで成 り、前記検出システムは前記信号の処理と分析の ためのシステムの入力に接続された出力に信号 を供給することを特徴とする請求項 4 記載の装 置。

- (6) 側方分散光学システムは回折格子であることを特徴とする請求項5記載の装置。
- (7) 倒方分散光学システムはプリズムである

装置。

- (10) 二次光ピームを空間的に分離する装置 は回折格子と、レンズ通過後は二次光ピームが平 行になるためのレンズとを含んで成っており、且 つ二次光ピームを重ねる装置は前記二次光ピーム が通過するレンズと、重ねられたピームを空間的 は光及び集光装置へと再度回帰させる回折格子と を含むことを特徴とする請求項8記載の装置。
- (11) 各二次光ビームの振幅を一時的に変調する装置は音響光学素子であることを特徴とする 詰求項8記載の装置。
- (12) 多色光源は少なくとも2つの波長が異なるピームを発光するレーザーであることを特徴とする請求項4記載の装置。
- (13) 多色光源は波長が異なるビームを発光 する少なくとも2つのレーザーから構成されることを特徴とする請求項4記載の装置。
- (14) 試験対象の方向に延びる一次光ピームを発する光源を具備する請求項1記載の方法を実行するための装置に於て、

ことを特徴とする請求項5記載の装置。

(8) 光源と遠光および集光装置との間の一次 光ピームの光路内に設けられた次の各装置即 ち、

各二次光ビームを空間的に分離する装置と、

特定周波数にて各二次光ビームの振幅を一時的に変調する装置と、

一次光ピームを再形成し、前記一次光ピームを 空間的は光装置及び集光装置へと向けるために各 二次光ピームを重ねるための装置と、

を含むことを特徴とする請求項4記載の装置。

(9) 各二次光ピームを問的に分類するのようのな過した次光ピームを通りたるでは、分離板を通りたが光ピームを反射して二次光ピームを反射して二次光ピームを反射して一次光ピームが多点を置けるのからはからないでは、一次の1つだけを反射しないことを特徴とする語求項8記載の

一次光ビームを複数の二次光ビームに分割し、 且つ各二次光ビームの振幅を特定周波数で、一時 的に変調する装置へ該二次光ビームを整然と送る ための装置と

各二次光ピームの異なる集光を可能にする集光 装置と、

二次光ビームを再結合し且つ回帰させ、一つの 一次光ビームを前記再結合により生成させるため の装置と、

第1集光システムと、

(15) 各二次光ピームの根幅変調は各二次光 ピームとも同一周波数で行なわれ、各変調の位相 は異なることを特徴とする請求項 1 4 記載の装置。

(16) 各二次光ビームの振幅変調は各二次光 ビームごとに異なる周波数にて行なわれることを 特徴とする請求項14記載の装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は拡張視野の走査共焦光学検験的かつ深度別的試験の方法と、前記の方法を実行するための装置に関する。

[従来の技術]

本発明はとくに高速度で実施される深度別拡張視野の検鎖光学画像の形成、とくにマイクロエレクトロニクス検査に係る。

一般に走査共焦光学検鎖法を実施するための手 類は次のとうりである。

集光システムに向けられる光ビームが形成される。

前記集光システムを用いてピームが研究対象に集光される。

F o は集光装置 1 4 を通過後のビームの焦点である。

対象16が集光装置14の焦点面の内側に置かれた場合、点F0の共役点はダイアフラム21の面の内側に位置する点F'0である。この面の内側の光点の寸法はそのとき最小であり、検出システム20により集められるエネルギは最大である。

分離板を用いて試験対象から反射した光ビームがデジタル検出、分析及び検出倡号の処理のためのシステムに送られる。

分離板から送られた照度が検出され、検出信号がデジタル方式で分析、処理される。

固定された対象に対して光ビームを移動するか、又は固定されたビームに対して対象を移動することによって研究対象上で光ビームの走査が行なわれる。

上記の方法を実行可能な公知の装置を第 1 図に 概略的に示す。

レーザーのような単色光源10から発する光ビームは空間的にフィルタをかけられ、集光装置12によって集光されるが、前記集光は例えばレンズを用いて、又、フィルタリング(光を光学用フィルタで処理すること。以下、週光ということがある。)は例えばダイアフラムによって行なわれる。それによってビーム断面に均一に配分される。それによってが開になる。次にビームはレンズのような集光装置14によって研究対象

対象が集光装置 1 4 の焦点面から離されると、対象から反射した光ビームの画像 F ´ i は F ´ o から離れる。ダイアフラム 2 1 の面の内側の光点は拡大し、検出システム 2 0 により集められる光エネルギは以前より大幅に小さい。

このようなダイアフラム21の存在において、 顕微鋭が実際の共焦モードで用いられる。ダイアフラム21は、これを用いずに得られる画像の解 像度と比較して約1.4倍の最終画像の解像度を 得ることを可能にする。

対象 1 6 上のビームの走査を行なうために用い 5 れる装置は第 1 図には図示していない。

この種の装置では、視野の深度は極めて小さく、0.3乃至0.5μmである。

第1 図に示す装置の使用を基本にして、拡張視野深度別光学国像形成を行なうことが可能である。例えば 0 . 5 μmの連続間隔の高さにてカットを行なうだけでよい。公知の方法で、高さ z i にて対象 1 6 の走査が行なわれ、次に対象 1 6 を装置の軸 z に沿って高さ z z まで移動させ、そこ

で新たに走査が行なわれ、以下同様である。

この方法はトニー・ウィルソン。コーリン・シェパード共著「走査光学検鏡法の理論と実際」 (1984年、アカデミック・ブレス刊)の第5 章123ページに開示されている。

[発明が解決しようとする課題]

獲得される視野の深度はその際、作成された連 統カッ♪ の数によって限定される。

[課題を解決するための手段]

本発明によって、試験対象16のピームによる

・試験対象の全てについて一次光ピームの走査を 行なう。

この方法の特徴に基づき、二次ビームはそれぞれについて固有な態様で一時的に変調される振幅 に於て相互に区別される。

なお、光ビームを単にビームということがある。

本発明は上記の方法を実行する装置をも含んでいる。この装置は、

試験対象の方向に延びる一次光ピームを発する光源と、

空間的進光及び集光装置と、

試験対象から反射した光ビームを戻す分離板と、

集光装置の共役点におかれたダイアフラムを 含んで成り、出力に信号を供給する検出システム と、

検出システムの出力に接続された入力を有する デジタル処理及び分析システムとから構成される。 単一の走査で拡張視野の深度別走査光学検鏡を実行することが可能である。連続的な画像取得が不要であり、従って完全な画像の取得速度が著しく縮まる。

本発明の厳密な目的は拡張視野の走査共焦光学 検鎖及び深度別試験の実施方法を提供すること である。この方法は以下の各段階から成ってい る。

・少なくとも1つの特性に於て相互に区別される 複数の二次光ビーム(要素光ビーム)から成る一 次光ビーム(該要素光を集合させた光ビーム)が 形成される。

- ・一次ピームを集光装置へと向ける。
- ・異なる高さのポイントで集光装置によって試験 対象上に各二次光ビームを集光する。
- ・試験対象から反射した二次光ピームを検出システムへと送る。
- ・二次ピームの照度を検出する。
- ・検出された信号をデジタル分析、且つ処理する。

前記光源は多色であり、一次光ビームは波長が異なる複数の二次ビームから成る。又、集光装置は色収差(波長によって異なる焦点に光が集光されること)を生じる。

この装置は各焦点面を区別せず、試験対象 1 6 の高低が現われない画像を供給する。すなわち 表面の細郎は当該表面の高さにかかわりなく同一面上に現われる。

一実施例では、装置は次のシステムを備えてい る。

分離板より戻された試験対象からの反射ビームの光路上に配置され、前記反射ビームを構成する 波長の異なる二次ビームを空間的に分離する側方 分散光学システム、及び、

倒方分散光学システムにより分離された二次 ビームをそれぞれ受けるのに適した検出システム である。各検出システムは集光装置の焦点の共役 点に配置されたダイアフラムを含んで成り、検出 システムは前記信号の処理と分析のためのシステ ムの入力に接続された出力に信号を供給する。 この上述の実施例によって試験対象の高低は再び確立されることができる。

視野の深度の範囲は集光装置の軸方向の色分散と、多色光源の色(波長)の拡張(広がり)に対応する。

一実施例では側方分散光学素子は回折格子である。

別の実施例では、側方分散光学素子はプリズムである。

別の実施例では本発明に基づく装置は光源と進光及び集光装置との間の一次ビームの光路内の次の装置から成っている。すなわち、

各二次ピームを空間的に分離する装置と、

特定の周波数でそれぞれの二次ビームの振幅を一時的に変調する装置と、

一次ピームを再形成するために各二次ピームを 重ねて、前記一次ピームを空間的濾光及び集光装 置へと向けるようにする装置である。

一実施例では、各二次ピームを空間的に分離する装置は分離板と、分離板を通過した後に残りの

別の実施例では、本発明に基づく装置は試験対象の方向に延びる一次光ビームを発する光源を具備している。それは更に、

一次光ピームを複数の二次ピームに分割し且つ 各二次ピームの振幅を特定周波数で一時的に変調する装置へ二次ピームを整然と送るための装置と、

各二次ピームの異なる集光を可能にする集光装置と、

二次ビームを再結合し且つ回帰させ、一次ビームを再結合により生成させる装置と、

第一集光システムと、

異なる高さにて二次ピームがそれぞれ集光されることを可能にする第2集光システムとを含み、

試験対象から反射したビーム、すなわち反対方向に装置の各業子を再通過した反射ビームの光路上の一次ビームの分離装置と光源との間に配置された分離板は進光及び集光システムを用いて前記反射ビームを検出システムへと送る。

一次ピームを戻して二次ピームを形成するミラーを含んでいる。二次ピームを重ねる装置は分離板と、一次ピームからの二次ピームの最初の分離から誘導された二次ピームを戻すためのミラーとを含んでいる。分離板は二次ピームの1つだけを反射し、別のピームは反射しない。

別の実施例では、二次ピームを空間的に分離する装置は回折格子と、レンズ通過後は二次光ピームが平行になるためのレンズとを含んでおり、又、二次ピームを重ねる装置は前記二次ピームが通過するレンズと、重ねられたピームを空間的進光及び集光装置へと回帰させる回折格子とを具備している。

一実施例では、それぞれの二次ビームの振幅を 一時的に変調する装置は音響光学素子である。

一実施例では多色光源は少なくとも2つの波長 が異なるピームを発光するレーザーである。

別の実施例では多色光源は波長が異なるビームを発光する少なくとも2つのレーザーから構成される。

上記装置の一実施例では、それぞれの二次ビームの振幅変調はそれぞれの二次ビームごとに同一周波数にて行なわれ、それぞれの変調の位相は異っている。

上記装置の一実施例では、それぞれの二次ビームの振幅変調はそれぞれの二次ビームごとに異なる周波数で行なわれる。

[実施例]

次に本発明の実施例を第3図乃至第7図を参照 しつつ詳細に説明する。これは単に説明上の実 施例であり、何ら本発明を限定するものではない。

第3図は本発明に基づく装置を示す。多色光源 11は複数の二次ピームから成る一次光ピームを発する。光源11は、活性物質がアルゴンであり且つ例えばいくつかの波長で光を放射するシーザーでよい。光源は例えば異なる波長で光を放射するいくつかのレーザーの組合せでもよい。一次ピームは断面の照度が均等に配分されたピームを得られるように集光及び選光装置12によって集 光され且つ空間的に強光される。これらの集光及 び進光装置12は例えばダイアフラム及び色消し レンズにより構成され、ダイアフラムの開口は色 消しレンズの焦点に位置している。

次に一次ピームは、例えば同一種類のガラス製のガラスは、例えば同一種類のガラス製のガラスはり軸色を生ずる集光される。それでは数対象(図示せず)上に再集光される。それでれの二次ピームは同一の焦点を有していたってなったは、nの全体数は一次にの高さの軸を力をしてない。焦点の軸を表わす軸zは装置の軸と合体する。

二次ピームは試験対象から反射して分離板 1 8 によって検出装置 2 0 へと戻される。

それぞれの探査ポイントについて試験対象が一次ピームによって走査されるとき、試験対象の表面上で正しく楽光された1つの二次ピームだけが、その焦点の共役点Pにて再集光される。一方、試験対象の表面上で集光される各ピームは、共役点Pである同一の焦点で集光装置30によっ

側方分散光学システム32が、試験対象から反射され、分離板18により戻される二次ビームの 光路上に配置されている。

このようにして、各二次ピームが空間的に分離され、それぞれが検出システム 2 0 に送られる。

第 4 図 B は、側方分散システム 3 2 が回折格子 3 2 ′でもよいことを示している。第 4 図 C は側方分散システム 3 2 はブリズム 3 2 ″でよいことを示している。

それぞれの検出システム 2 0 は各二次ビームの 焦点の共役点 P に配置されたダイアフラム 2 1 を 含んで成っている。

検出装置20はその出力から、分析及び処理装置22によりデジタル分析・処理される信号を発する。

デジタル処理の後、この装置は試験対象のそれ ぞれの探査ポイントについて、対象の表面上で正 しく集光された二次ピームの高さを復元すること が可能である。 て再集光される。

検出装置 2 0 の一郎を形成するダイアフラム 2 1 の存在によって、試験対象の表面上に正しく 集光されない二次ピームを観光することが可能と なる。

検出システムは一つの出力で処理及び分析装置 2 2 によってデジタル分析・処理される信号を発 する。

この装置は試験対象の表面上で正しく集光された全てのビームを均等に処理する。これは対象の 高低に関する情報を提供せず、例えば 0 . 5 μ m の特定の厚さにおよぶ対象の表面状態に関する情報を提供するのみである。

試験対象の高低の分析と処理を可能にするため、本発明に基づく発明の変型が第4図Aに提案されている。

第4図Aは簡略化のために、高さz」、z2及びz2にて集光される3つの二次ビームを示しているが、決してこれに限定されるものではない。

本発明に基づく装置の別の態様でも同一の結果を得ることが可能である。

検出システム20は分離板18により戻された それぞれの二次ピームを復調する装置から成って いる。

第6図は二次ピームを分離し、根幅変調し且っ それらを再結合することが可能な別の装置を示 す。 光々から発する一次としてない。 とは回折格子40によって、二次とはのかによって、二次との伝播方のの伝播方のの伝播方ののではない。 である。ではない。)である。ではいるではない。)ではない。)ではない。)ではない。)ではいるには、一時のにはいるでは、これらの変調装置36は音響光学素子でよい。

二次ピームはレンズ 4 4 及び回折格子 4 6 によって再び重ねられ、空間的露光及び集光装置 1 2 (第 6 図では図示せず)に送られる。

本発明に基づく装置の別の実施例を第7図に示す。

レーザーのような光顔10が一次ピームを発する。

一次ピームを等しい照度の複数の二次ピームへ と分割する装置 5 2 が一次ピームの光路上に配置 されている。

これらの装置は例えば分離板である。これらの

ビームは異なる高さ(zı, z₂, z₂) にて集 光される。

二次ピームは試験対象(図示せず)から反射して装置の各条子を逆方向に再び通過する。分離板50によって反射ピームは濾光及び集光システム12に戻ることができる。試験対象の表面上で集光された二次ピームだけが検出システム20に送られる。検出システム20によって出力に送られた信号はそこで分析及び処理システム22によってデジタル分析・処理される。

[発明の効果]

以上の通り、本発明の請求項(1)ないし(3)の方法及び請求項(4)ないし(16)の 装置によると、試験対象のビームによる単一の走 査で拡張視野の深度別走査光学検鏡を実行することが可能である。また、連続的な顕像取得が不要であり、従って完全な顕像の取得速度が著しく縮まる。

本発明によると、 拡張視野の走査共焦光学検鏡 及び深度別試験の正確にして確実な実施が可能で 分離板を通過後、これも二次ビームを形成する 残りの一次ビームはミラー 5 3 によって反射する。

この図では限定するためではなく簡略化のため に3つの二次ビームだけを示す。

それぞれの二次ビームは、例えば音響光学素子でもよい変調装置によって、特定周波数にて一時的に振幅変調される。

変調後、それぞれの二次ビームは例えば焦点距 雌が異なるレンズである集光装置 5 1 を通過し て、二次ビームのそれぞれ異なる集光が可能となる。

各二次ビームは再結合装置 5 2 によって一次 ビームを再形成できるように再結合され、反射ミ ラー 5 3 によって、半透明板を一次ビームが通過 したことにより生じる二次ビームが別の二次ビー ムと再結合することが可能となる。

振幅変調された二次ピームから成る一次ピーム は第1集光システム54を通過し、次に第2集光 システム56を通過する。このようにして各二次

ある.

4. 図面の簡単な説明

11…光源、 12…進光及び集光装置、

14 … 集光装置、 16 … 試驗対象、

18 … 分離板、 20 … 検出システム、

21…ダイアフラム、

22… 処理及び分析装置、

3 2 … 側方分散システム、

3 2 ~ … 回折格子、 3 2 ~ … プリズム、

3 4 … 分越装置、 3 6 … 変爾装置、

38 … 重ね装置、 40 … 回折格子、

42 … レンズ、 44 … レンズ、

4 6 … 回折格子、 5 2 … 再結合装置、

5 6 … 第 2 集光システム。

代理人 弁理士 冀 野 廟

